

採用企業向け、卒業生アンケートの 結果について

キャリアセンター / IR推進室

2022年9月21日

採用企業向け卒業生アンケート

実施時期：2022年9月7日～16日

回答社数：24社

回答企業の業種



ここ5年間（2017年～2021年の間）の間に、貴社に採用された、本学卒業生の能力についての印象を教えてください。

【側面1-1】熱意がある

【側面1-2】主体性がある

【側面1-3】チャレンジ精神がある

【側面2-1】コミュニケーション能力が高い

【側面2-2】ストレス耐性が高い

【側面2-3】柔軟性、適応力がある

【側面3-1】論理的思考ができる

【側面3-2】高い教養を身に付けている

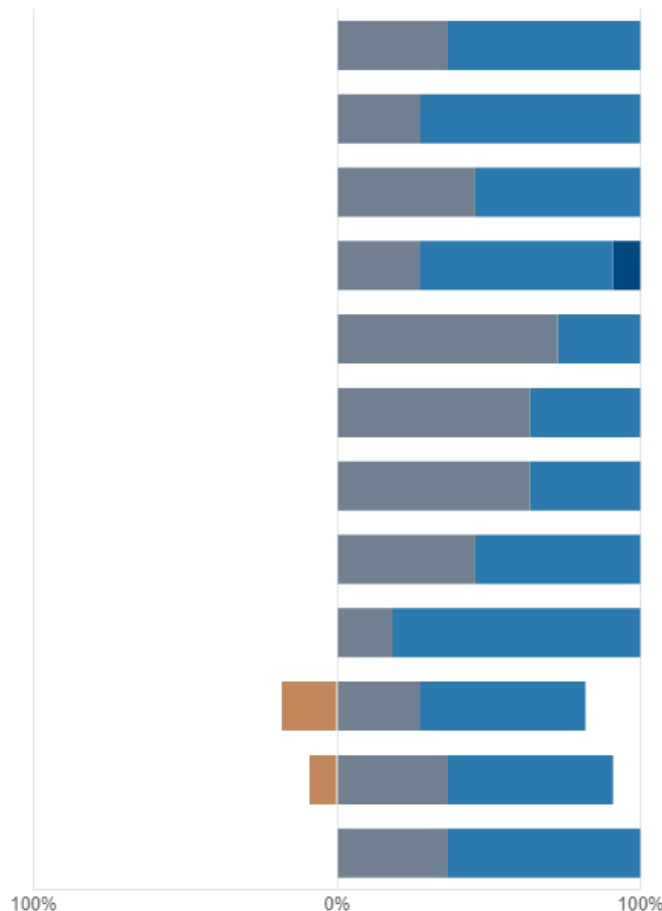
【側面3-3】理解力がすぐれている（地頭（じあたま）がよい）

【側面4-1】創造力がある

【側面4-2】個性がある

【側面4-3】着眼点が良い

■ 1：まったくそう思わない ■ 2：そう思わない ■ 3：どちらでもない ■ 4：そう思う ■ 5：とてもそう思う
■ 0：5年間（2017年～2021年の間）の間に上智大学卒業生を採用していない。



全般的にポジティブななか、

【側面1-2】 主体性がある

【側面2-1】 コミュニケーション能力

【側面3-3】 理解力がすぐれている

地頭（じあたま）がよい

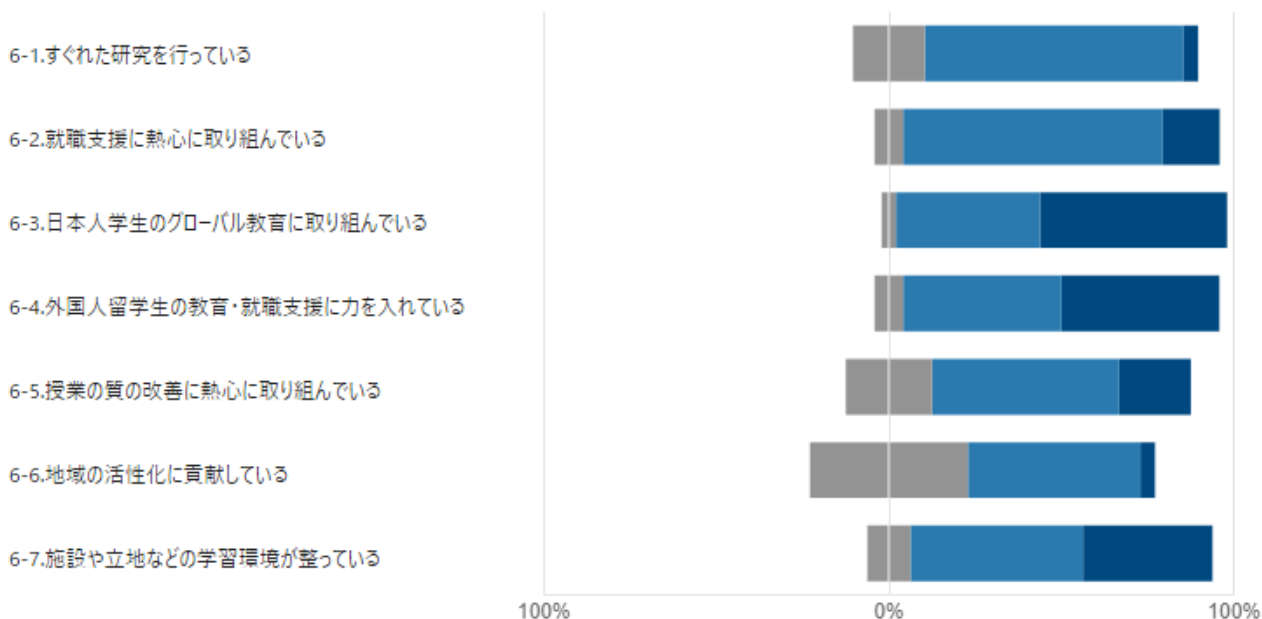
【側面4-2】 個性がある

【側面4-3】 着眼点が良い

の印象が強い

上智大学の取り組みについて、印象を教えてください。

■ 1 : まったくそう思わない ■ 2 : そう思わない ■ 3 : どちらでもない ■ 4 : そう思う ■ 5 : とても思う



全般的にポジティブななか、

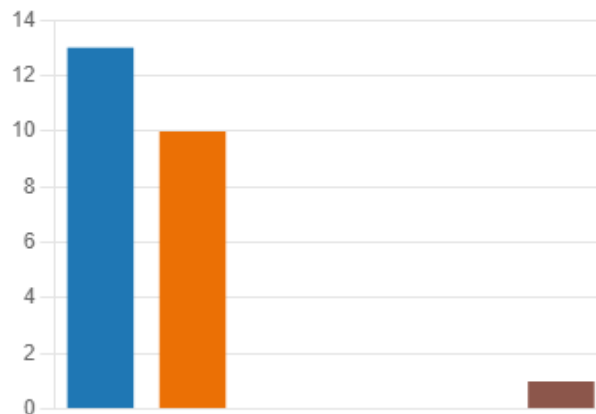
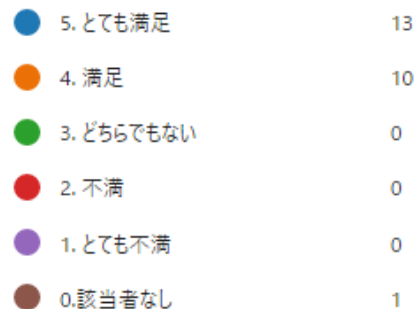
6-3.日本人学生のグローバル教育に取り組んでいる

6-4.外国人留学生の教育・就職支援に力を入れている

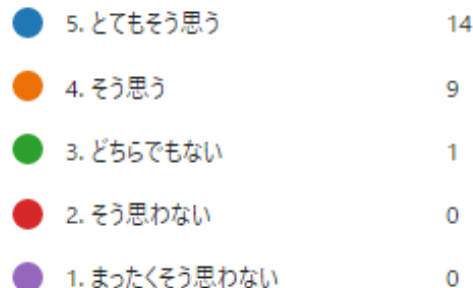
6-7.施設や立地などの学習環境が整っている

の印象が強い

ここ5年間（2017年～2021年の間）の間に、貴社に採用された、
本学卒業生についての満足度についてお答えください。



今後、本学卒業生の採用を、増やしていきたいと思いますか？



本学卒業生の印象について教えてください①

- ・そつなく何事にも取り組み、仕事の基礎能力が高い印象を持っている。
- ・バランス感覚が良く、コミュニケーション能力が高い学生が多い印象。
- ・主体的に取り組むことができ、自分自身で考え行動できる、とても魅力的な学生が多い印象。
- ・ポジティブ：グローバルな視点を持つ学生が多い。語学力も非常に高い。
- ・ネガティブ：非営利活動を多くやっている方が多い印象。ビジネスは営利となるため、やや営利であるビジネス感覚を持てておらず、非営利活動の考え方をめぐえていない学生もいる。
- ・個性的で論理的思考力が高い学生が多い印象。
- ・着眼点や発想が角度を変えるようなものも多く、早期から活躍している学生が多い印象。
- ・他大学の学生より外国語に精通している印象が強く、初期配属から海外とのコミュニケーションが必要な部署に配属されるケースも多い。
一般的な教養やビジネス上求められる素養の高い人材も多く、入社後に活躍している。
- ・地頭だけではなく、コミュニケーション力を有しているため、優秀な印象を受けている。
- ・明るくコミュニケーション力に長けた人材が多く、社内でも初年度から活躍している学生が多い印象がある。

本学卒業生の印象について教えてください②

- ・ 弊社のグローバルな事業展開に興味を持ってくれる学生が多い印象。
- ・ 語学など専攻の分野以外にも優れた知識や興味関心をもち、幅広い分野で活躍したいという熱意を感じる学生に入社してもらっている。
- ・ 個性豊かな人財がいる。
- ・ 柔軟な発想ができる学生が多い。
- ・ 国際的視点の多様な想像力がある学生が多い。
- ・ 学力だけでなく行動力があり、新しい領域に挑戦することを怖がらない学生が多い印象。
- ・ やや大人しく、上品。個人の意見を押し付けることはなく、賢さを備えている印象。
- ・ 国際的な教養が高い印象。特に女性が多い印象。
- ・ 問題意識・課題意識が深い。
- ・ グローバルへの関心が高い。
- ・ 語学力が高い。
- ・ 理系学生は専門性が高い上に、部門を超えた連携ができる弊社の理念への共感度が高い。上智大学への母校愛がある。
- ・ 地頭が良く、論理的に筋道立てた話をする学生、ホスピタリティに溢れた学生が多い印象。
- ・ 主体性があり、自ら行動する学生が多い印象。



上智大学
SOPHIA UNIVERSITY

FOR OTHERS, WITH OTHERS

本資料に関する、お問い合わせ先：

IR推進室 ir_office@ml.sophia.ac.jp